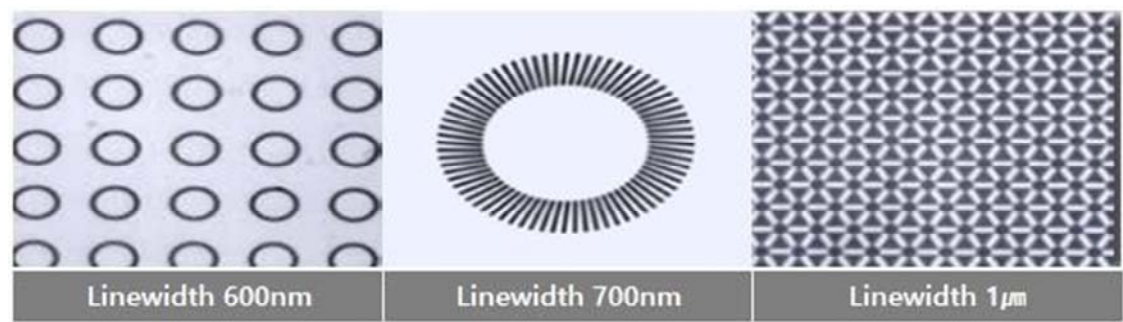


半導體產業應用

在高度精密的半導體製程中，光罩扮演關鍵角色。宸軒科技憑藉先進設備與製程能力，提供適用於各類半導體製程的高解析度客製化光罩，包含晶圓製造、封裝測試、微機電系統（MEMS）等應用。我們能依據客戶設計圖稿、線寬規格與材質需求，精準製作符合規格的光罩，協助客戶加速開發流程、提升製程良率與產品競爭力。

製程能力 Mask Specifications



規格	4"x4"~7"x7"	9"X9"	~14"x14"	14"x14" ~700mmx800mm
最小線寬	0.6um	1um	3um	3um
CD精度	±0.06um	±0.1um	±0.25um	±0.5um
位置精度	±0.1um	±0.1um	±0.25um	±0.25um
套合精度	1um	1um	2um	3um
檔案格式	GDSII,·DWG,·DXF,·Gerber,·OBD**,·CIF...			
材質	Quartz·&·Soda·lime·&Borosilicate			

(特殊尺寸請來信詢問)

圖形檢驗 Inspect for defect

☆ 機台 : AOI (TR-1100L . TRINITY-PRO J . TRINITY-PRO . TRINITY)

☆ 目的: 量測光罩之圖形完整性 (defect & particle)

☆ AOI 機台能力 : 可檢至 0.25um



Model : TR-1100L
Maker : TRIVIS
(KOREA)
Install : 2021.06



Model : KLA351
Maker : KLA (USA)
Install : 2022.11

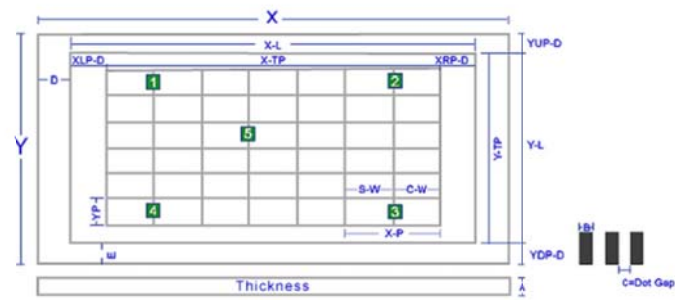
SPECIFICATIONS (um)	TR-1100L	KLA351
Open	≥ 0.5	≥ 0.25
Short	≥ 0.5	≥ 0.25
Protrusion	≥ 0.5	≥ 0.25
Pin Hole	≥ 0.6	≥ 0.25
Space Hole(Island)	≥ 0.6	≥ 0.25

精度檢驗 Measurement

機台：SOKKIA (UMIC-1100S、 UMIC-300)

☆ 目的: 量測光罩精度，Total pitch，正交度

- 具雷射干涉儀系統
- 恆溫恆濕CHAMBER
- 光源校正系統
- STAGE水平，高低差校正
- 自動量測系統



UMIC-300		UMIC-1100S	
Work size	250x250mm	Work size	1100x1200mm
Measure precision(short)	3σ=0.01um	Measure precision(short)	3σ=0.15um
Measure precision(long)	3σ=0.05um	Measure precision(long)	3σ=0.35um